MEMS 变形反射镜主要特性测试*

陈家凤1,陈海清2

(1 中南民族大学 电子信息工程学院,武汉 430074) (2 华中科技大学 光电子科学与工程学院,武汉 430074)

摘 要:介绍了基于微机电系统技术的微变形反射镜的基本结构和电极分布.分析了微机系统变形 镜的变形原理,推导了微变形镜的镜面变形与外加驱动电压的关系.分析了基于计算机控制的频闪 显微干涉测量系统的组成及测试原理,并利用该系统实现了对微变形镜静态电压-位移曲线、静态 面形、动态离面变形以及谐振频率的测试.实验表明,测试结果与理论分析有很好的一致性. 关键词:光学测量:MEMS变形镜:频闪显微干涉测量系统:特性

中图分类号:TN247

文献标识码:A

文章编号:1004-4213(2009)12-3245-5

0 引言

微机电系统(Microelectromechanical System, MEMS) 变形镜(MEMS Deformable Mirrors, MEMS-DMs)是 MEMS 技术应用于自适应光学系 统中的新型变形反射镜,是自适应光学系统中的重 要部件,通过在可控驱动器上施加控制电压,可产生 所需的镜面变形,从而改变反射光束的波前相位以 达到校正畸变波前的目的.因此,MEMS-DMs的性 能指标尤其是动态指标直接关系到到整个自适应光 学系统的性能.所以采用合适的测试方法[1-3]对 MEMS 变形镜的主要特性进行测试就显得至关重 要.本文的测试对象是 AgilOptics 公司生产的 MEMS-DMs. 测试内容包括微变形镜静态电压-位 移曲线的测试、静态面形的测试、动态离面变形的测 试以及谐振频率的测试.由于 MEMS-DMs 具有整 体重量轻、成本低、能耗低、惯性小、振幅低、响应频 率高和集成度高等特点,同时 MEMS-DMs 反射面 的特点又决定了不能使用侵入式测量,对测试仪器 精度要求高.因此,针对 MEMS-DMs 自身的特点, 本文采用频闪显微干涉法^[4-6]对 MEMS-DMs 的主 要特性进行测试.

MEMS-DMs 结构及变形理论 1

AgilOptics 公司提供的 MEMS-DMs 是采用微 加工技术制作而成的平板静电驱动连续薄膜式变形 镜,其基本结构如图 1. 该变形镜的薄膜是通过在涂 了氮化硅层的1mm厚的硅片上远离掩模区域蚀刻

Tel:15972060768 收稿日期:2008-09-23 硅而形成.为了提供高的光学反射率以及薄膜对激 励的传导率,在薄膜上下表面分别沉积了反射层和 传导层.然后在独立的硅片衬底阵列上形成镀金驱 动电极阵列,最后将薄膜和衬底阵列晶片用一个可 传导的固定尺寸的间隔装置结合起来形成完整的变 形镜.该变形镜的电极分布及结构如图 2,该变形镜 具有 38 个驱动电极(含公共极),每个电极均为正六 边形.当在驱动电极上施加控制电压后,电极与薄膜 之间就会产生静电力引起薄膜向下凹陷,从而在对 应的区域产生所需要的变形.



图1 微变形镜剖面

Fig. 1 Cross section of an AgilOptics' Deformable Mirror



图 2 MEMS-DMs 电极分布

Fig. 2 Channel assignments for 37 actuator mirror

静电驱动式微变形镜的一个重要特征是能够准 确地控制镜面变形,对连续薄膜变形镜,每个驱动电 极施加电压后对膜面的变形均有影响.由于

^{*}航天支撑技术基金(041.3JW05)和中南民族大学自然科 学基金(YZY06003)资助

Email: jfchen2003@yahoo. cn 修回日期:2008-12-31

MEMS-DMs 的镜面厚度远小于镜面直径,因此可 以认为变形镜的薄膜是弹性膜.又因为镜面薄膜的 变形足够小,属于线性弹性变形,所以在镜面上任意 一点的变形都垂直于原始镜面.当变形镜的变形量 远小于薄膜与电极间的距离时,变形镜上每一点的 变形量应与单个电极所加电压的平方成线性关系, 而且膜面的整体变形可看成是各个电极单独作用的 线性组合,因此连续薄膜变形镜上某点(x,y)的变 形量 u(x,y)与外加电压 V_t 的关系为

$$u(x,y) = \sum_{k=1}^{n} V_{k}^{2} \varphi_{k}(x,y)$$
(1)
设 $f(V_{k}) = V_{k}^{2},$ 则方程(1)可表示为
 $u(x,y) = \sum_{k=1}^{n} f(V_{k}) \varphi_{k}(x,y)$ (2)

式(1)中的n=37代表驱动电极的数目, V_k 是 对第k个驱动电极施加的控制电压, $\varphi_k(x,y)$ 是第k个电极的面形影响函数^[7-8],表示当单个电极(第k个)上施加单位控制信号而其它驱动电极仅由弹性 约束时,变形镜镜面所引起的变形.将方程(2)用矢 量-矩阵形式可表示为

$$u(x,y) = f(\mathbf{V})\boldsymbol{\varphi}(x,y)^{\mathrm{T}}$$
(3)
 $\vec{\mathbf{x}} \neq \mathbf{V}$

$$\boldsymbol{\varphi}(x,y) = [\varphi_1(x,y), \varphi_2(x,y), \cdots \varphi_n(x,y)],$$

$$\boldsymbol{V} = [V_1, V_2, \cdots V_n].$$

当变形镜的变形量非常微小时,变形镜的面形影响 函数 $\varphi_k(x,y)$ 可用 Zernike 多项式表示为

$$\varphi_n(x,y) = \sum_{b=1}^m a_{kb} z_p(x,y) \tag{4}$$

式中 m 代表 Zernike 多项式的项数,取 m=n-1=36(其中第一项是常数项), $z_p(x, y)$ 为第 p 项 Zernike 多项式,系数 a_{kp} 对应第 k 个电极作用时的 第 p 项 Zernike 系数. 将方程(4)用矢量-矩阵形式 表示为

$$\boldsymbol{\varphi}(x,y)^{\mathrm{T}} = A \boldsymbol{z}(x,y)^{\mathrm{T}}$$
(5)

式中 $z(x,y) = [z_1(x,y), z_2(x,y), \dots z_m(x,y)]$ 是 1×m阶 Zernike 多项式矢量, A 是 $n \times m$ 阶面形影 响矩阵. 将方程(5)代入方程(3)可得

 $u(x,y) = f(\mathbf{V})A\mathbf{z}(x,y)^{\mathsf{T}} = B\mathbf{z}(x,y)^{\mathsf{T}}$ (6) 式中 $B = f(\mathbf{V})A$ 表示变形镜表面面形的 $1 \times m$ 阶 Zernike 多项式系数矩阵. 对 A 求广义逆可得

 $f(\mathbf{V}) = B \cdot A^{T} \cdot (A \cdot A^{T})^{-1} = B \cdot C$ (7) 式中 $C = A^{T} \cdot (A \cdot A^{T})^{-1}$ 是控制电压矩阵. 很显 然,知道了变形镜的控制电压矩阵,就可以控制变形 镜的各驱动电极上的电压以获得所需要的镜面变 形,从而达到波前校正的目的.

2 测试系统

采用图 3 的频闪显微相移干涉系统对 MEMS-

DMs的电压-位移静态曲线、静态表面面形及动态 特性进行测试. 若去掉遮光闸,则该系统是一个改进 的泰曼-格林干涉仪,利用 PZT 使参考平面镜产生 微位移可控制参考光束和测量光束的光程差,最终 改变其相位差从而在测试过程中精确地产生相移步 距为 $\pi/2$ 的 - 套 5 步 相 移 干 涉 图 像. 为 实 现 MEMS-DMs 的动态测量,系统采用 658 nm 的脉冲 激光二极管作频闪光源,并采用美国 NI 公司的 PCI-MIO-16E-1型多功能数据采集卡实现计算机 同步控制及数据采集,使频闪光的闪光频率与对 MEMS-DMs 施加的周期性激励信号的频率相同, 控制激励周期内频闪光脉冲与周期性激励信号的相 对延时,再配合5步相移干涉技术,即可利用普通 CCD 拍摄到激励周期内不同时刻的多套"冻结"的 5 步相移干涉图像.由于 MEMS 变形镜在周期性激励 信号的作用下不仅存在离面运动,同时还存在平面 内运动,因此还必须进行面内运动的测量.这时利用 遮光闸遮住射向参考平面镜的光线,则测量系统变 为频闪显微视觉系统,调整频闪光脉冲与该周期性 激励信号的相对延时,可获得激励周期内不同时刻 的多幅视觉图像,再利用数字图像相关技术即可进 行面内运动测量. 消除面内运动的影响后即可获得 MEMS-DMs 在激励周期内不同时刻的三维形貌 图,最终可得到动态测试所需的特性参数.



图 3 频闪显微干涉测量系统

Fig. 3 Schematic map of stroboscopic interferometer system 在进行动态测试时,对应于激励周期内各时刻 的干涉图样中任意点的光强分布函数可表示为 $I_i(x,y,t) = A(x,y,t) + B(x,y,t) +$

 $2\sqrt{A(x,y,t)B(x,y,t)}\cos \{\phi(x,y,t)+\theta\}$ (8) 式中 $\phi(x,y,t)$ 为代表某一时刻被测 MEMS 变形镜 表面高度信息的两相干光束的相位差, A(x,y,t)、 B(x,y,t)分别为从参考平面镜和被测 MEMS 变形 镜反射回来的两束相干光束的光强分布. θ 为移相 量.采用相移步距为 π/2 的 5 步相移算法(即 Hariharan 算法)可得到与物体表面信息有关的各 时刻的缠绕相位 $\Psi(x,y,t)$.

$$\Psi(x,y,t) =$$

$$\arctan \frac{2(I_t(x,y,t) - I_4(x,y,t))}{2I_3(x,y,t) - I_5(x,y,t) - I_1(x,y,t)}$$
(9)

式中 $I_1(x,y,t)$, $I_2(x,y,t)$,..., $I_5(x,y,t)$ 分别代 表对应不同相移量时各时刻的光强分布. 很显然从 式(9)得到的相位值是用反正切函数表示的,其相位 值被缠绕在主值区域[$-\pi$, $+\pi$]中. 因此为了获得 反映物体信息的真实相位 $\phi(x,y,t)$, 就必须将相位 主值恢复为绝对相位,即必须进行相位解缠^[9-10]. 在 采用加权小波变换^[11]及时间相位解缠算法进行相 位解缠并消除面内运动的影响后,通过式(10)即可 获得被测 MEMS-DMs 表面任意一点在各时刻的高 度 h(x,y,t), 从而得到其表面形貌及离面变形等参 数. 式(10)中的 λ 为光源的波长.

$$h(x,y,t) = \frac{\phi(x,y,t)}{4\pi} \lambda \tag{10}$$

3 MEMS-DMs 特性测试实验

MEMS-DMs的光学影响函数矩阵已由方迪 等^[12]进行了测试.本文主要是利用图3的频闪显微 干涉测量系统实现对 MEMS-DMs的静态电压-位移 曲线、静态形貌、动态离面变形以及谐振频率的测试. 图4是在测试微变形镜静态形貌时(变形镜各个电极 均未加控制电压时)采用频闪显微干涉系统并利用5 步相移干涉法测得的其中一幅干涉图,图5是利用式 (9)得到的缠绕相位图,图6是进行相位解缠操作后 并利用式(10)得到的变形镜原始表面形貌图.



图 4 干涉图 Fig. 4 Interferogram map



Fig. 5 Wrapped phase map



图 6 静态形貌图 Fig. 6 Static surface shape map

在进行静态响应曲线测试时,本文测试的是变 形镜中心位置的变形与中心电极所施加的电压的关 系曲线.在 0~200 V工作电压范围内,每间隔10 V 给中心电极施加一个驱动电压,利用频闪显微干涉 系统及 5 步相移算法以及相位解缠算法可测试出此 时对应的变形镜中心电极施加电压后的静态电压一 位移曲线(图 7).显然,从图 7 可以看出:微变形镜 的电压一位移关系是非线性的,且变形镜中心位置 的变形与中心电极所加电压的平方成线性关系,这 与前面分析的变形镜的变形理论非常吻合.



Fig. 7 Static curve of voltage-displacement

在进行变形镜动态测试时,系统通过函数发生 器为变形镜提供频率为1kHz、有效值为20V、直 流偏置为100V的正弦激励信号.在激励周期内采 样16个点,可得到对应不同时刻的16套(每套5 幅)干涉图像,利用 Hariharan 算法、相位解缠算法 及相位-高度转换公式并消除平面内运动的影响后 可得到变形镜表面各点在各时刻的离面变形.图8 是将变形镜各驱动电极均加上该激励信号时得到的 镜面中心位置的动态离面变形图.对该中心位置的 离面变形进行20次重复测量,其重复误差不大于 5 nm.通过改变激励信号的频率可实现对 MEMS 变形镜的谐振频率的测量,实验测得变形镜的谐振 频率为1kHz,与该变形镜的固有频率一致,从而验证了测量方法的可行性及测试结果的准确性.



4 结论

通过分析 MEMS 微变形反射镜的变形原理,推 导了变形反射镜光学影响函数矩阵,从而得到了电 压控制矩阵,为自适应光学系统利用微变形镜进行 波前校正提供了理论依据.针对 MEMS 变形镜具有 尺寸小、响应频率高及低振幅的振动特性的特点,利 用所构建的频闪显微干涉系统实现了对 MEMS-DMs 的静态电压-位移曲线、静态面形、动态离面变 形以及谐振频率的测试,实验结果验证了与理论分 析的一致性以及测试结果的准确性、可靠性.

参考文献

- [1] JIAO Guo-hua, LI Yu-lin, HU Bao-wen. Mirau phase-shifting interferometer for profile measurement of microlenses arry[J]. Acta Photonica Sinica, 2007, 36(10):1924-1927. 焦国华,李育林,胡宝文. Mirau 相移干涉法测量微透镜阵列面 形[J]. 光子学报,2007,36(10):1924-1927.
- YU Rui-zhi, CAO Yi-ping. A three dimensional on-line inspecting method for workpiece by PMP[J]. Acta Photonica Sinica, 2008, 37(6):1139-1143.
 喻睿智,曹益平.一种采用相位测量轮廓术的工件在线三维检

测方法[J]. 光子学报,2008,37(6):1139-1143.

[3] DUAN Cun-li, CHEN Fang, QI Rui-li, et al. A new moiré stripe method of measuring 3-D object shapes [J]. Acta Photonica Sinica, 2008, 37(7):1425-1428. 段存丽,陈芳,祁瑞利,等.利用莫尔条纹测量物体三维貌方法 研究[J].光子学报,2008,**37**(7):1425-1428.

- [4] HART M R, CONANT R A, LAU K Y, et al. Stroboscopic interferometer system for dynamic MEMS characterization[J]. IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical System, 2000,9(4):409-418.
- [5] REMBE C, MULLER R S. Measurement system for full threedimensional motion characterization of MEMS [J]. IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, 2002, 11(5):479-488.
- [6] XIE Yong-jun, BAI Jin-peng, SHI Tie-lin, et al. Measurement system for 3D static and dynamic characterization of MEMS.
 [J]. Journal of Optoelectronics Laser, 2005, 16(5):570-574.
 谢勇君,白金鹏,史铁林,等. MEMS 三维静动态测试系统[J].
 光电子 激光, 2005, 16(5):570-574.
- [7] LI En-de, DUAN Hai-feng, DAI Yun, et al. Analysis of characteristics of micromachined membrane deformalbe mirror
 [J]. Hign power laser and particle beams, 2006, 18(7):1099-1103.

李恩德,段海峰,戴云,等.微加工薄膜变形镜特性分析[J].强 激光与粒子束,2006,18(7):1099-1103.

- [8] YU Yang, CAO Gen-rui. A study on the corrective capability and optimization of active mirror [J]. Journal of Beijing Institute of Technology, 2003, 23(2):229-233.
 于洋,曹根瑞.主动光学反射镜面形的校正能力及其优化设计 [J].北京理工大学学报, 2003, 23(2):229-233.
- [9] BALDI A, BERTOLINO F, GINESU F. On the performance of some unwrapping algorithms [J]. Optics and lasers in Engineering, 2002, 37(4):313-330.
- [10] KIM S B, KIM Y S. Least squares phase unwrapping in wavelet domain [J]. IEE Proc -Vis Image Signal Process, 2005,152(3):
- [11] CHEN Jia-feng, CHEN Hai-qing. Weighted least squares phase unwrapping algorithm based on multiresolution wavelet transform[J]. Journal of Optoelectronics Laser, 2008, 19 (4):514-517.
 陈家凤,陈海清.基于小波变换的加权最小二乘相位解缠算法 [J].光电子 激光,2008,19(4):514-517.
- [12] FANG Di, CHEN Hai-qing, LI Jun, et al. The measurement of some important parameters of mems deformable mirror[J]. Optical Instruments, 2005, 27(3):21-26.
 方迪,陈海清,李俊,等.微变形反射镜主要性能测试研究[J]. 光学仪器, 2005, 27(3):21-26.

Primary Characteristics Measurement of MEMS Deformable Mirrors

CHEN Jia-feng¹, CHEN Hai-qing²

(1 College of Electronics and Information Engineering, South-Central University for Nationalities, Wuhan 430074, China)
 (2 Institute of Optoelectronic Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: The fundamental structure and channel assignments for actuator mirror of deformable mirrors based on microelectromechanical system (MEMS) technique are introduced. The deformation principle of MEMS deformable mirrors(MEMS-DMs) is analyzed. The relation between the deformation of the mirror surface and the voltages applied to the mirror electrodes is deduced. The composition and testing principle of the computer-controlled stroboscopic microscopic interferometer system are analyzed. The static voltage versus displacement curve, surface shape map and out-of-plane-deflections and resonant frequency of MEMS-DMs are measured. The experiment shows that the test results agree well with the theory analysis. **Key words**: Optical measurement; MEMS deformable mirrors; Stroboscopic microscopic interferometer system; Characteristics



CHEN Jia-feng was born in 1968. She is an associate professor at South-Central University for Nationalities with the Ph. D. degree. Her research interests focus on optoelectronic detecting and information processing.